

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-114157
(43)Date of publication of application : 21.04.2000

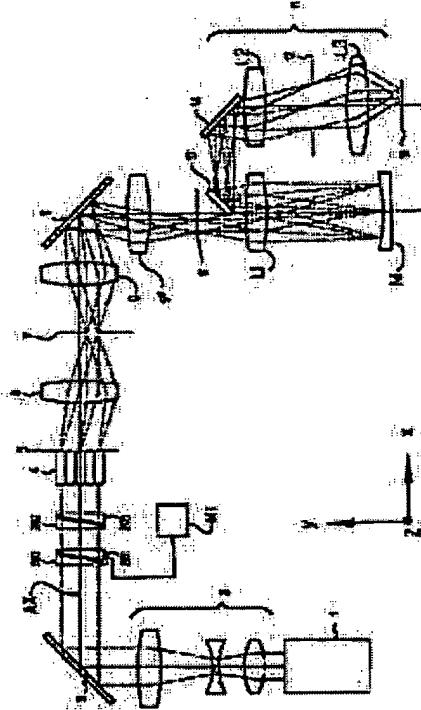
(51)Int.Cl. H01L 21/027
G03F 7/20

(21)Application number : 10-290118 (71)Applicant : NIKON CORP
(22)Date of filing : 29.09.1998 (72)Inventor : KOMATSUDA HIDEKI

(54) ILLUMINATOR AND PROJECTION ALIGNER PROVIDED THEREWITH**(57)Abstract:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily adjust the polarization ratio of a light source by direction to an arbitrary intensity ratio with respect to an arbitrary direction, by providing an condenser optical system and a double-diffracting member arranged in the optical path between a light source section and a wavefront dividing section, in such a way that the member can rotate around the advancing direction of luminous fluxes.

SOLUTION: Luminous flux from a light source 1 is led to a fly-eye lens 4 through a first set of wedge-shaped prisms 200 and 201 and a second set of wedge-shaped prisms 202 and 203, and the wavefront of the luminous flux is divided through the lens 4, resulting in a plurality of light source images. The light rays from the light source images are reflected by 90° with a reflecting mirror 8 after passing through lenses 6 and 9 and illuminate a mask 10 through a lens 9'. Here, a condenser optical system is constituted of the lenses 6, 9, and 9'. In addition, the crystal prism 200 and quartz prism 201 are constituted in such a way that the prisms 200 and 201 can be rotated integrally around the optical axis AX by means of a motor MT.



*** NOTICES ***

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]A light source which supplies light flux, and a wavefront-splitting part which carries out wavefront splitting of the light flux from this light source, and forms two or more light source images based on this light flux by which wavefront splitting was carried out. A lighting system being arranged in an optical path between condenser optical systems which lead light from said two or more light source images to a predetermined illuminated field on an irradiated plane, and said light source part and said wavefront-splitting part, and having a double refraction member in which a direction of movement of light flux was established pivotable as a center.

[Claim 2]The lighting system according to claim 1, wherein said double refraction member has the form from which thickness of said direction of movement differs in a cross sectioned direction of said light flux.

[Claim 3]The lighting system according to claim 1 or 2 with which said double refraction member is characterized by this few **** of at least one of two double refraction elements being pivotable considering said direction of movement as a center including at least two double refraction elements.

[Claim 4]The lighting system according to claim 3, wherein at least one of said double refraction elements is allocated so that the direction of the optical axis may serve as an abbreviated perpendicular to a direction of movement of light flux.

[Claim 5]The lighting system according to claim 3 which said predetermined illuminated field is approximately rectangular shape, and at least one of said double refraction elements is fixed, and is characterized by the direction of an optical axis of said fixed double refraction element being parallel to the direction of a neighborhood of said rectangular shape.

[Claim 6]The lighting system according to claim 5, wherein said fixed double refraction element is arranged between said pivotable double refraction element and said wavefront-splitting part.

[Claim 7]A projection aligner having a projection optical system which carries out projection exposure of a lighting system given in any 1 clause of Claims 1-6 which illuminate a mask in which a predetermined pattern was formed, and the pattern of a this illuminated mask on a sensitized substrate.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the lighting system carried in a suitable projection aligner and this equipment, in order to manufacture a projection aligner, especially Integrated Circuit Sub-Division, etc.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, the light source wavelength of the projection aligner is carrying out short wavelength formation with high integration of Integrated Circuit Sub-Division. For example, the projection aligner using a KrF excimer laser as a light source is already put in practical use, and the equipment using an ArF excimer laser is shifting to a practical use stage from a research stage. In the projection aligner which uses these laser as a light source, since the wavelength of a light source is short, the ** material which can be used as a transmission member is restricted to silica glass and a fluorite. Therefore, it will face carrying out the optical design of the projection lens of a projection aligner, and amendment (achromatism) of a chromatic aberration will be extremely difficult. the oscillation wavelength of principle top excimer laser — half breadth — several commas — it has an about [nm] wavelength interval. For this reason, in order to ease prosaic terms and conditions, narrow band-ization is performed so that an oscillation wavelength may become a number pm grade of commas with half breadth. Here, if narrow band-ization of an oscillation wavelength is performed using a diffraction grating etc., in addition to amplification of a specified wavelength, only a specific polarization component will be amplified. And if projection exposure is performed using the light flux which has many specific polarization components, the problem described below will be produced.

[0003] If it exposes by using light flux which polarized as a light source, the phenomenon in which the image formed eventually changes with directions of a pattern will arise. For example, when light flux is polarizing in the meridional direction, in the image surface, an image with small NA is formed in this direction. When polarizing in the sagittal direction, an image with large NA is formed in this direction. Therefore, since image formation will be carried out by NA partial in the image surface if illumination luminous flux is polarizing even if it carries out image formation of the pattern formed in the mask etc. by the projection optical system of uniform NA even if, resolving will change with directions of a pattern. In high NA, this phenomenon is especially remarkable. Since it is indicated in detail in the present age optics for a Yasushi Oki: "freshman, optical [near the focus]", optics, and the 21 (1992) August item, it omits.

[0004] On the other hand, as for Integrated Circuit Sub-Division, the mainstream is shifting to a logical circuit from a memory circuit. Integrated Circuit Sub-Division for logical circuits has the independent independent pattern, and it is desirable for pattern line width to be uniform. If resolving changes with directions of a pattern in Integrated Circuit Sub-Division for logical circuits, since the fall of the processing speed of a logical circuit will be caused, it is not desirable. For this reason, ArF or a KrF excimer laser is used as a light source, for example, it corresponds by the method described below in the conventional projection aligner currently indicated by the patent No. 2679319 gazette.

[0005] Drawing 6 is a figure showing the outline composition of the conventional projection aligner. The sectional shape of the light flux to eject the light flux from the excimer laser 1 which is a rectangle, It is changed into the light flux of suitable form and an aspect ratio by the plastic surgery optical system 2, and it enters into the fly eye lens 4 which is an optical element which has arranged the single lens with high density in parallel, after penetrating the quartz plate 100 and the silica glass 101 which are mentioned later. Drawing 7 is the figure which observed the fly eye lens from the direction of movement (x shaft orientations) of light flux. After the light flux divided for every element lens with the fly eye lens 4 penetrates the lens 6, the field diaphragm 7, and the lens 9, it is bent 90 degrees by the reflective mirror 8, penetrates lens 9', and is condensed on the mask 10. Here, a condenser lens group is constituted in the lenses 6, 9, and 9'. The situation of the beam of light of a to [from fly eye lens 4 entrance plane / the mask 10] is shown in drawing 8 (a) and (b). Since it is simple, in drawing 8, the optical system from the lens 6 to the lens 9 is only indicated to be lens LL. In drawing 8 (a), the light flux a which condensed to the entrance plane of the fly eye lens 4 is condensed with condensing lens LL by position a' on the 10th page of a mask. That is, each element lens entrance plane and the mask 10 of the fly eye lens 4 are constituted by conjugate. As shown in drawing 8 (b), the light flux b which condensed to the projection surface of the fly eye lens 4 is changed into a parallel beam in lens LL, and irradiates with the mask 10. As a result, wavefront splitting of the light flux which entered into the fly eye lens 4 is carried out per element lens, and it is piled up on the mask 10. And based on the illumination light supplied to the mask 10, the pattern on the mask 10 is transferred by the wafer 15 according to the projection optical system 11. The projection optical system 11 comprises the lens L1, L2, L3, the mirrors 13 and 14, and the reflective concave mirror M, and has the aperture diaphragm 12. Here, the field diaphragm 7 was allocated by the mask 10 in the condenser lens groups 6-9, and the conjugate position, and has specified the illumination range. Fly eye lens 4 projection surfaces are the aperture diaphragm 12 of a projection lens, and conjugate.

The illumination system aperture diaphragm 5 is allocated in the projection surface of the fly eye lens 4.

[0006] Generally the form of the light flux ejected from the excimer laser 1 as mentioned above is a rectangle, and is polarizing in parallel with a rectangular shorter side. In order to keep the efficiency of Lighting Sub-Division high as much as possible, it is

desirable to make the laser emitted light flux of rectangular shape fit the outside of the fly eye lens 4 as much as possible according to the plastic surgery optical system 2 which comprised a cylindrical lens etc. Drawing 9 is a figure showing the relation of the laser emitted light flux alpha and the fly eye lens 4 which were operated orthopedically. The polarization direction po is parallel to the rectangular neighborhood. Since fly eye element lens entrance planes are the mask 10 and conjugate, an illumination range is prescribed by the outer diameter of a fly eye element lens. For this reason, since change of NA of the image formation light flux which originates in the above polarization directions since polarization parallel to the neighborhood of the illuminated field of rectangular shape is supplied on the mask 10 which is an illuminated face is produced, it is not desirable.

[0007]

[Problem to be solved by the invention] In order to solve the problem resulting from polarization, the composition which acquires false available light is explained. The crystal component 100 which is the uniaxial crystal processed into the wedge shape is allocated between the light source 1 and the fly eye lens 4. And only by the crystal component 100, since the direction of movement of light flux bends by a refractive action, in order to amend a direction of movement, the silica glass 101 processed into the wedge shape like the crystal component 100 is allocated like drawing 6.

[0008] Relations with a fly eye lens are indicated to be the direction of the optical axis of the crystal component (uniaxial crystal) 100, and a polarization direction to drawing 10 (a) – (c). The sectional shape of the light flux alpha which enters into the fly eye lens 4, and the figure (b) show the optical axis opax of a crystal component, and, as for drawing 10 (a), the figure (c) shows the form of the fly eye lens 4, respectively. The optical axis opax of a crystal component is vertical to the direction of movement of light flux, and is set as the angle of 45 degrees to the polarization direction po. According to this composition, since the crystal component 100 is processed into the wedge shape, the thickness (transmission distance) which penetrates a crystal component by the position into which light flux enters differs. For this reason, the polarization condition of the light flux to eject changes with incidence positions to crystal. for example, a case [like drawing 11 (a)] whose polarization direction of the incident light which enters into the crystal component 100 is -- polarization of exit light -- vertical linear polarization (drawing 11 (b)), horizontal linear polarization (drawing 11 (d)), and those middle circular light (drawing 11 (c), (e)) -- it becomes elliptically polarized light further. And since the wave front of various polarization conditions is divided and piled up by penetrating a fly eye lens and a condensing lens, on the mask 10, the state which polarization of various directions overlapped, i.e., false available light, can be acquired. Thus, the unevenness of NA in an image formation face (wafer 15) and the variation of resolving of a pattern which carried out image formation based on the light flux of a specific polarization condition can be prevented by using the crystal component 100.

[0009] However, a projection aligner of the above-mentioned composition has a problem described below. In order that a actual projection aligner may bend a direction of movement of light flux from Reasons of a miniaturization of equipment, etc., two or more reflective mirrors are used. A projection aligner shown in drawing 6 has the four reflective mirrors 3, 8, 13, and 14. For example, if bending of the mirrors 3 and 4 is lost and an optical system is arranged to straight line shape, it will be an optical system whose overall length is very long. If bending of the mirror 13 is lost, arrangement of an optical system will become impossible physically.

[0010] Therefore, in an optical system of a projection aligner, a reflective mirror is an indispensable optical element. However, to light of short wavelength oscillated from an ArF excimer laser etc., a reflective mirror with equal reflectance of an P wave and an S wave cannot be manufactured. For this reason, even if it illuminates a mask by available light by bending light flux by a reflective mirror, there is a problem that light flux will be polarization feeling on exposed sides, such as a wafer. Even if it changes laser oscillation light of linear polarization into false available light on a mask surface by making a crystal component penetrate like equipment before, it will be the light flux which has specific polarization components, such as p ingredient or s ingredient, by bending an optical path by a reflective mirror in a subsequent optical system. Therefore, variation in pattern resolving by unevenness of NA at the time of carrying out image formation on a wafer resulting from a specific polarization component and line width will be produced.

[0011] It is possible by rotating a laser light source and a plastic surgery optical system, and rotating the incoming beam to a crystal component itself here, in order to prevent change of the ratio of the polarization component by bending of light flux in equipment conventionally to change the ratio by the direction of polarization. However, if the incoming beam itself is rotated and the direction of specific polarization is doubled with the bending direction of a mirror, when the form of light flux and the direction of polarization are fixed, rectangular light flux will rotate and enter to a rectangular fly eye lens. As a result, since the rectangular area of a fly eye lens and the rectangular area of light flux are not in agreement and light flux is kicked with a fly eye lens, light volume will not be able to be used effectively but decline in illumination efficiency will be caused.

[0012] In light of the above-mentioned problems, this invention is a thing.

The purpose is to provide a projection aligner provided with the lighting system which can adjust the ratio by the direction of ** to arbitrary intensity ratios simple to arbitrary directions, and this lighting system.

[0013]

[Means for solving problem] In order to solve an aforementioned problem, in the invention according to claim 1. The light source which supplies light flux, and the wavefront-splitting part which carries out wavefront splitting of the light flux from this light source, and forms two or more light source images based on this light flux by which wavefront splitting was carried out. It is arranged in the optical path between the condenser optical systems which lead the light from said two or more light source images to the predetermined illuminated field on an irradiated plane, and said light source part and said wavefront-splitting part, and has the double refraction member in which the direction of movement of light flux was established pivotable as a center.

[0014] In the invention according to claim 2, said double refraction member has the form from which the thickness of said direction of movement differs in the cross sectioned direction of said light flux.

[0015] As for at least one of two double refraction elements, as for said double refraction member, in the invention according to claim 3, this few **** is characterized by being pivotable considering said direction of movement as a center including at least two double refraction elements.

[0016] In the invention according to claim 4, at least one of said double refraction elements is allocated so that the direction of the optical axis may serve as an abbreviated perpendicular to the direction of movement of light flux.

[0017] In the invention according to claim 5, said predetermined illuminated field is approximately rectangular shape, at least one of said double refraction elements is fixed, and the direction of the optical axis of said fixed double refraction element is characterized

by being parallel to the direction of the neighborhood of said rectangular shape.

[0018]In the invention according to claim 6, said fixed double refraction element is arranged between said pivotable double refraction element and said wavefront-splitting part.

[0019]In the invention according to claim 7, it has a projection optical system which carries out projection exposure of a lighting system given in any 1 clause of the Claims 1-6 which illuminate the mask in which the predetermined pattern was formed, and the pattern of the this illuminated mask on a sensitized substrate.

[0020]

[Mode for carrying out the invention]Hereafter, an embodiment of the invention is described based on an accompanying drawing. (A 1st embodiment) Drawing 1 is a figure showing the composition of the lighting system concerning a 1st embodiment of this invention, and a projection aligner provided with this lighting system. Expansion of a luminous flux diameter and change of an aspect ratio are made by the plastic surgery optical system 2 in which the light flux from the light sources 1, such as an ArF excimer laser (wavelength lambda = about 193 nm), contains a cylindrical lens etc. As for the light source 1, it is desirable to eject linear polarization parallel to space. Next, the light flux operated orthopedically penetrates the group 200,201 of the 1st wedge-action-die prism, and is led to the fly eye lens 4 through the group 202,203 of the 2nd [further] wedge-action-die prism. The prism 200-203 is processed into the wedge shape that the thickness of a direction of movement differs in the cross sectioned direction of light flux. The details about the prism 200-203 are mentioned later. Next, wavefront splitting of the light flux from a light source is carried out with the fly eye lens 4, and two or more light source images are formed. The aperture diaphragm 5 for determining the numerical aperture of the illumination light on a wafer surface is formed in the projection surface of the fly eye lens 4. And after the light from two or more light source images penetrates the lens 6 and the lens 9, it is bent 90 degrees by the reflective mirror 8, and illuminates the mask 10 which penetrates lens 9' and has a pattern. Here, condenser optical systems consist of the lens 6, the lens 9, and lens 9'. The field diaphragm 7 is arranged at the mask 10 in condenser optical systems, and the conjugate position. And based on the illumination light supplied to the mask 10, the pattern on the mask 10 is transferred by the wafer 15 according to the projection optical system 11. The projection optical system 11 comprises the lens L1, L2, L3, the mirrors 13 and 14, and the reflective concave mirror M, and has the aperture diaphragm 12. Thus, as for the projection optical system 11 of this embodiment, it is desirable to have a reflector of mirror 13 grade. Here, the field diaphragm 7 was allocated by the mask 10 in the condenser optical systems 6-9, and the conjugate position, and has specified the illumination range. The projection surfaces of the fly eye lens 4 are the aperture diaphragm 12 of a projection lens, and conjugate.

[0021]Next, the prism 200-203 is explained. The prism 200 and the prism 202 comprise the crystal crystal processed into the wedge shape. Since an optical path bends by a refractive action that it is only crystal prism as the above-mentioned conventional technology described, the direction of movement of light flux has been amended by combining the silica glass 201 and 203 processed into the wedge shape, respectively. The angle of the wedge of each prism is set up so that the light flux which entered at right angles to prism may eject almost vertically. And the crystal prism 200 and the quartz prism 201 are constituted by motor MT pivotable considering the optic axis AX as a center as one. On the other hand, the crystal prism 202 and the quartz prism 203 are being fixed.

[0022]The direction of the optical axis of the crystal prism 200 and 202 is shown in drawing 2 (a) and (b), respectively. Here, it is vertical to x and an optic axis in the direction of an optic axis, and y and a direction vertical to the space of drawing 1 are set to z for the direction of [in the space of drawing 1]. The angle of the optical axis opax of the crystal prism 200 and the y-axis to make is set to psi. As shown in drawing 2 (b), the direction of the optical axis opax of the crystal prism 202 currently fixed is parallel to the direction of the neighborhood of the field of the rectangular shape on a mask illuminated. However, when light flux is bent by the mirror etc., it thinks as a thing without bending. As for at least one of the crystal prism 200 and 202, it is desirable to be allocated so that the direction of the optical axis may serve as an abbreviated perpendicular to the direction of movement of light flux.

[0023]In this embodiment, all the bending directions of the reflective mirrors 8 and 13 and 14 grades are the hands of cut to an axis vertical to the space of drawing 1. For this reason, polarization of a direction with polarization of a direction with light flux parallel to the space of drawing 1 on the 15th page of a wafer vertical to space weakness becomes strength. for this reason, the intensity ratio of polarization of the light flux formed by the prism 200,202 — a y direction — strength and the direction of z — slight weakness — and it can be necessary to choose that ratio arbitrarily. It is changed into polarization of various states after the light flux of the linear polarization of a y direction penetrates the prism 200,201. If its attention is paid only to linear polarization before long, as shown in drawing 3, the intensity ratio is divided into the linear polarization of a y direction, and the y-axis and the polarization which makes the angle of (psix2) by 1:1. If the prism 202,203 is penetrated, the linear polarization of a y direction will be passed as it is, without receiving change at all, and the polarization which makes the y-axis and the angle of (psix2) will be divided into the polarization which makes the angle to the y-axis (psix2), and the polarization which makes the angle of -(psix2) to the y-axis by the intensity 1:1. This situation is shown in drawing 4. That is, in the polarization intensity of A and the direction of z, the polarization intensity of the y direction after penetrating the prism 200-203 will be set to A:B=1+cos(2 psi):sin (2 psi), if angle of rotation of B and the crystal prism 200 is set with psi. This shows that polarization of there being few numerousness [a y direction] and directions of z can be acquired in this embodiment. Since it is variable, the angle of rotation psi can choose the ratio of A and B arbitrarily. Preferably, it is desirable to rotate the crystal prism 200 so that the ratio of the quantity of polarization by a direction may become equal, and to choose psi, measuring the amount of polarization on the 15th page of a wafer.

[0024](A 2nd embodiment) Since the fundamental composition of a projection aligner provided with the lighting system concerning a 2nd embodiment of this invention and this lighting system is the same as that of a 1st embodiment of the above, the explanation by figures is omitted. A different point from a 1st embodiment of the above is one of the points of using only the group 200,201 of the 1st wedge-action-die prism instead of the prism 200-203. The polarization condition acquired by rotating the direction of the optical axis of the crystal prism 200 by motor MT around the optic axis AX is shown in (c) from drawing 5 (a). Since circular light does not become a problem in this case, only linear polarization is illustrated. When the angle on which an optical axis and a polarization direction make (a) is 45 degrees (the same figure as drawing 11), in the case of 30 degrees, (c) of (b) is a case of 60 degrees. In this method, polarization of a specific oblique direction (the direction of an optical axis) can be strengthened so that more clearly than a figure. To face bending light flux by a mirror like a 1st embodiment and bend to an axis parallel to which neighborhood of a rectangular radiation field, the intensity ratio of polarization requires that only the ratio of a 2-way (y in drawing 1, the direction of z) parallel to the neighborhood of the rectangle of light flux should change. However, when there are no restrictions in the bending direction by a

mirror, the crystal prism 200 can be rotated for the change ***** direction, and the direction of an optical axis and the intensity ratio of polarization can be coincided. Therefore, the intensity ratio of the direction to desire can be changed by rotating the one crystal prism 200.

[0025]Although the illumination system which used only one fly eye lens was used in the above-mentioned embodiment, two or more groups of a fly eye lens and a condensing lens may be provided in series, and the illumination system which performs wavefront splitting of light flux and superposition two or more times may be used. For example, generally the composition which arranged 2 sets of groups of a fly eye lens and a condensing lens in series is called a double fly eye system. As for birefringence mediums, such as a crystal component, in this composition, it is desirable to count sequentially from the light source side and to arrange to the light source side rather than the 1st fly eye lens.

[0026]

[Effect of the Invention]As explained above, the intensity ratio of polarization of a specific direction is controllable by the invention according to claim 1 by rotating a double refraction member. Therefore, the influence of polarization of the light which reaches on the exposed side (wafer) resulting from the method of bending by the mirror of light flux can be lost.

[0027]The double refraction member differs [invention / according to claim 2] in the thickness of the direction of movement of light flux in the cross sectioned direction of light flux. Therefore, since the distance which penetrates this component by the position of the light flux which enters into a double refraction member differs when linear polarization enters, it is an injection side and polarization of various states is acquired.

[0028]In the invention according to claim 3, it has at least two double refraction elements, among those one side is pivotable. Therefore, the intensity ratio of polarization of arbitrary directions is controllable.

[0029]In the invention according to claim 4, the direction of an optical axis is an abbreviated perpendicular to the direction of movement of light flux. Therefore, control of the amount of polarization becomes still easier.

[0030]In the invention according to claim 5, the illuminated field on a mask is approximately rectangular shape, and the direction of the optical axis of the double refraction element fixed is parallel to the direction of the neighborhood of said rectangular shape.

Therefore, even when the sectional shape of the light flux which ejected from the laser light source and was operated orthopedically is rectangular shape, it can illuminate efficiently without the loss of light volume, and the intensity ratio of polarization can be controlled according to the direction of the neighborhood of an illuminated field.

[0031]In the invention according to claim 6, the fixed double refraction element is arranged between the pivotable double refraction element and the wavefront-splitting part. therefore, since the driving rotary part of the mirror is separated from the optical system of a fly eye lens etc., stable Lighting Sub-Division is performed — things can be carried out.

[0032]In the invention according to claim 7, by using the lighting system concerning this invention, the influence of polarization depending on the bending direction of light flux can be avoided, and the pattern of always good resolving can be projected and exposed.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1]It is a figure showing the composition of the lighting system concerning an embodiment of the invention, and the projection aligner provided with it.

[Drawing 2]It is a figure explaining the direction of the optical axis of crystal prism.

[Drawing 3]It is a figure explaining the situation of the polarization after penetrating the crystal prism 200.

[Drawing 4]It is a figure explaining the situation of the polarization after penetrating the crystal prism 200 and 202.

[Drawing 5]It is a figure explaining the situation of polarization at the time of rotating the crystal prism 200.

[Drawing 6]It is a figure showing the composition of the conventional projection aligner.

[Drawing 7]It is a figure showing the composition of a fly eye lens.

[Drawing 8](a) and (b) are the figures explaining the system from a fly eye lens to a mask.

[Drawing 9]It is a figure showing the relation of the laser emitted light flux alpha and the fly eye lens 4 which were operated orthopedically.

[Drawing 10](a) – (c) is a figure showing a relation with a fly eye lens with the direction of the optical axis of the crystal component (uniaxial crystal) 100, and a polarization direction.

[Drawing 11](a) – (e) is a figure showing the state of polarization of the exit light from the crystal component 100.

[Explanations of letters or numerals]

1 Light source

2 Plastic surgery optical system

3, 8, 13, and 14 Reflective mirror

200,202 Crystal prism

201,203 Quartz prism

4 Fly eye lens

5 Aperture diaphragm

6, 9, and 9' condensing lens

7 Field diaphragm

10 Mask

L1, L2, and L3 Lens

11 Projection optical system

12 Aperture diaphragm

15 Wafer

M Concave surface mirror

[Translation done.]

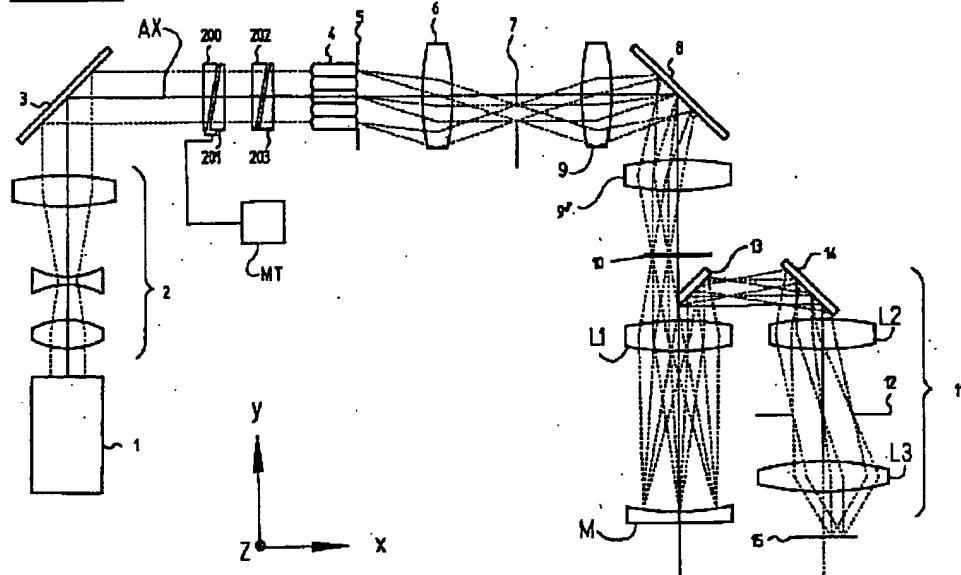
* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

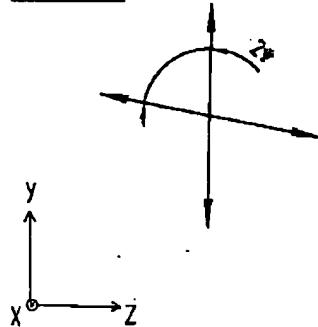
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

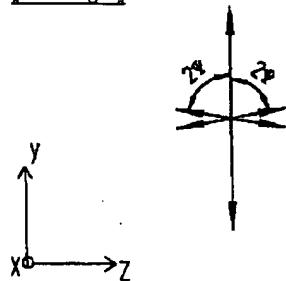
[Drawing 1]



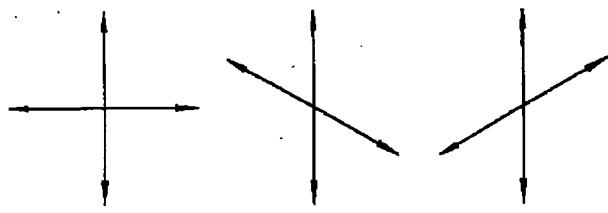
[Drawing 3]



[Drawing 4]



[Drawing 5]

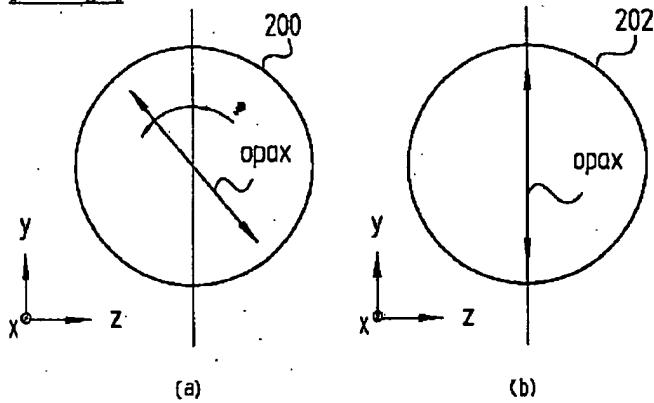


(a)

(b)

(c)

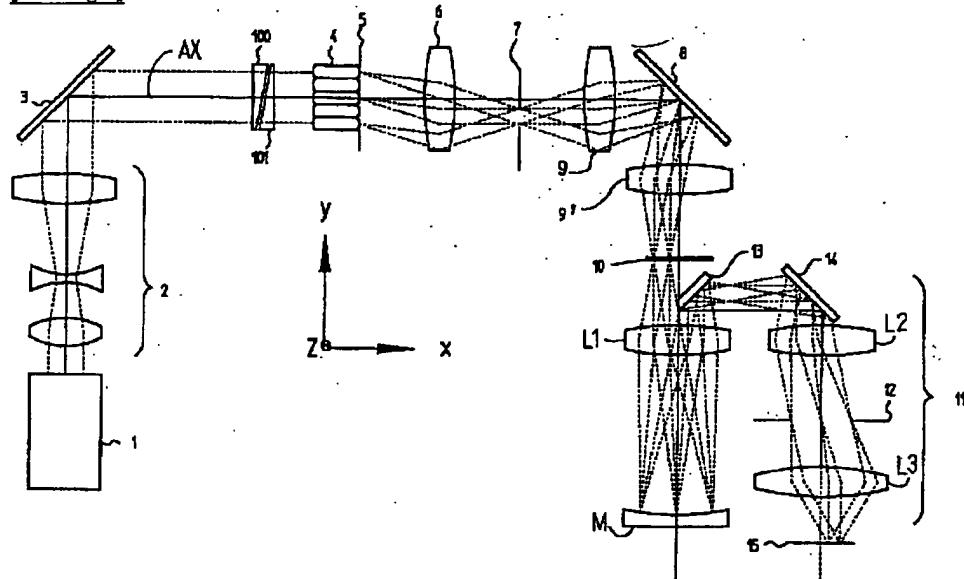
[Drawing 2]



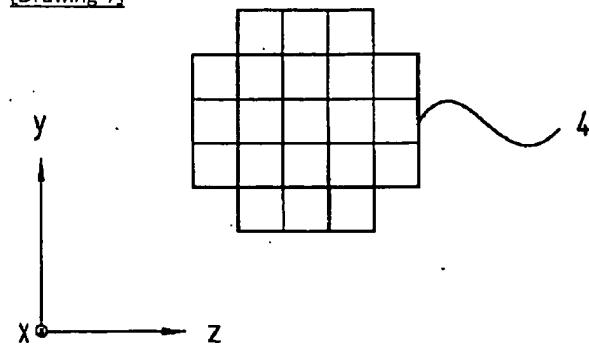
(a)

(b)

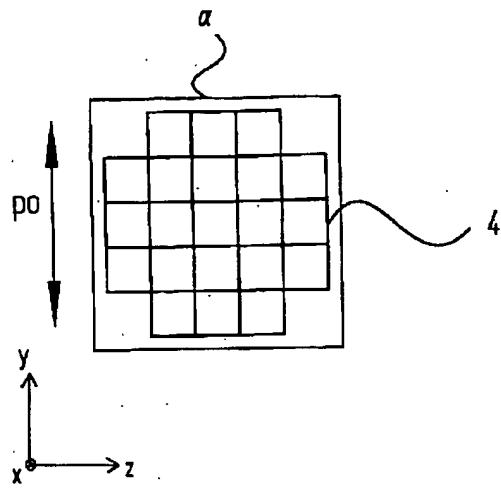
[Drawing 6]



[Drawing 7]

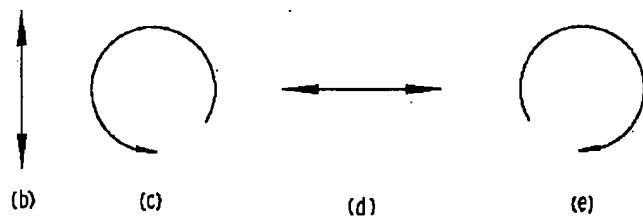


[Drawing 9]

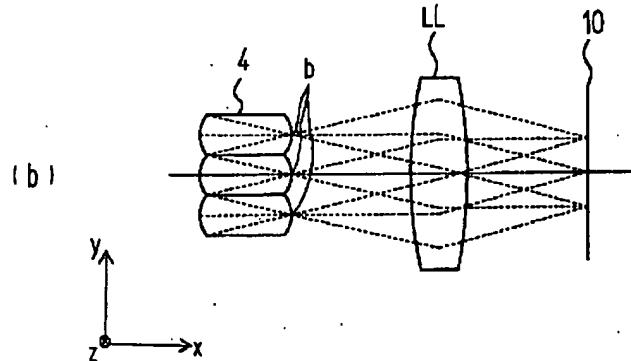
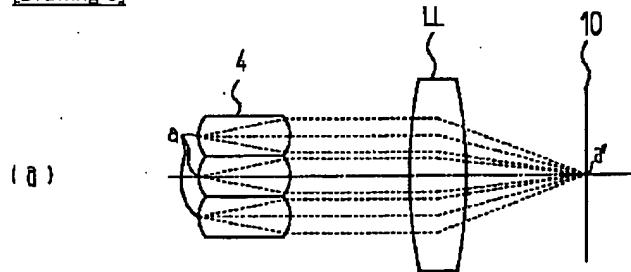


[Drawing 11]

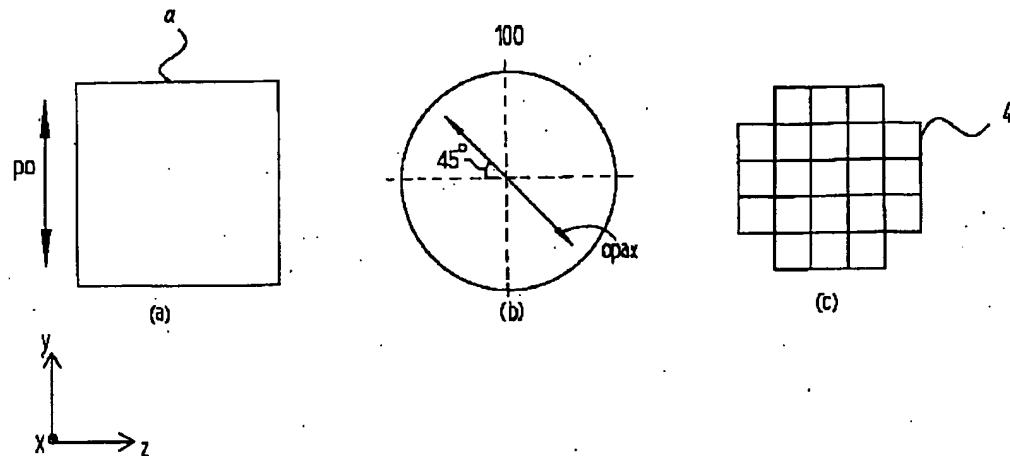
(a)



[Drawing 8]



[Drawing 10]



[Translation done.]

**Espacenet**

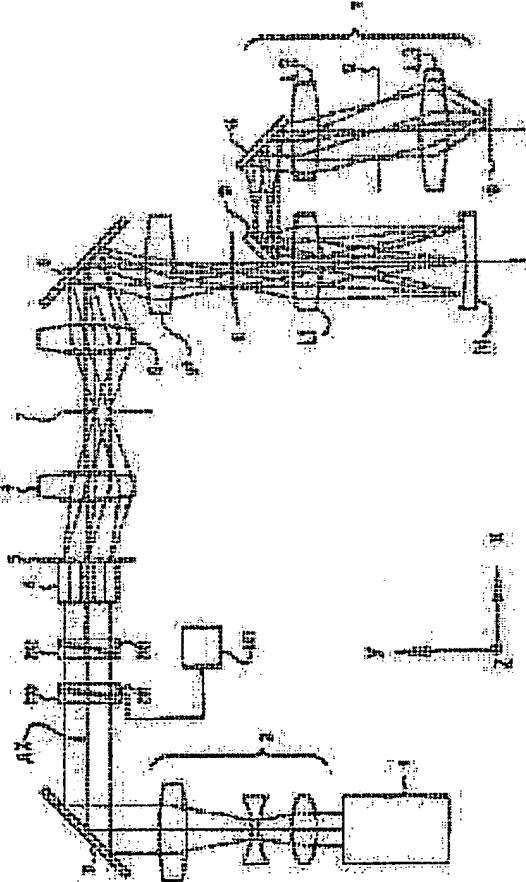
Bibliographic data: JP 2000114157 (A)

ILLUMINATOR AND PROJECTION ALIGNER PROVIDED THEREWITH

Publication date: 2000-04-21
Inventor(s): KOMATSUDA HIDEKI ±
Applicant(s): NIPPON KOGAKU KK ±
Classification:
- international: G03F7/20; H01L21/027; (IPC1-7): G03F7/20; H01L21/027
- European: G03F7/20T14
Application number: JP19980290118 19980929
Priority number(s): JP19980290118 19980929
Also published as:
• JP 4065923 (B2)

Abstract of JP 2000114157 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily adjust the polarization ratio of a light source by direction to an arbitrary intensity ratio with respect to an arbitrary direction, by providing an condenser optical system and a double-diffracting member arranged in the optical path between a light source section and a wavefront dividing section, in such a way that the member can rotate around the advancing direction of luminous fluxes. **SOLUTION:** Luminous flux from a light source 1 is led to a fly-eye lens 4 through a first set of wedge-shaped prisms 200 and 201 and a second set of wedge-shaped prisms 202 and 203, and the wavefront of the luminous flux is divided through the lens 4, resulting in a plurality of light source images. The light rays from the light source images are reflected by 90 deg. with a reflecting mirror 8 after passing through lenses 6 and 9 and illuminate a mask 10 through a lens 9'. Here, a condenser optical system is constituted of the lenses 6, 9, and 9'. In addition, the crystal prism 200 and quartz prism 201 are constituted in such a way that the prisms 200 and 201 can be rotated integrally around the optical axis AX by means of a motor MT.



Last updated:
04.04.2011 Worldwide
Database 5.7.20; 92p

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-114157

(P2000-114157A)

(43)公開日 平成12年4月21日 (2000.4.21)

(51)Int.Cl.

H 01 L 21/027

G 03 F 7/20

識別記号

5 0 2

5 2 1

F I

H 01 L 21/30

C 03 F 7/20

H 01 L 21/30

テーマコード(参考)

5 1 5 D 2 H 0 9 7

5 0 2 5 F 0 4 6

5 2 1

5 2 7

審査請求 未請求 請求項の数7 FD (全8頁)

(21)出願番号

特願平10-290118

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 小松田 秀基

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内

(74)代理人 10007/919

弁理士 井上 義雄

Fターム(参考) 2H097 BB10 CA06 CA13 GB01 LA10

5F046 BA03 CA04 CB02 CB05 CB10

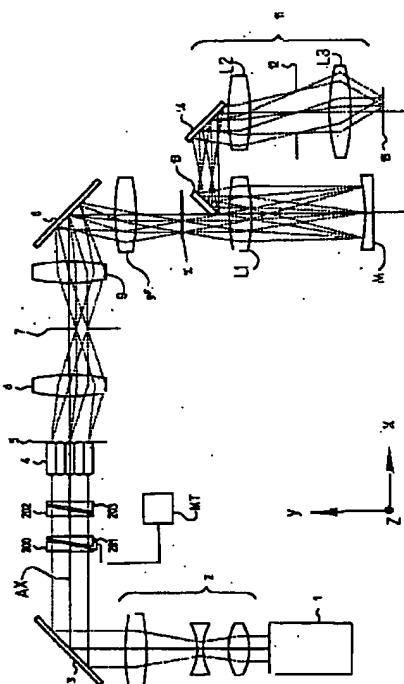
CB13 CB23 CB25 DA01 DA12

(54)【発明の名称】 照明装置及び該照明装置を備える投影露光装置

(57)【要約】

【課題】 光源の偏光の方向による比を、任意の方向に對して任意の強度比に簡便に調整できる照明装置及び該照明装置を備える投影露光装置を提供すること。

【解決手段】 光束を供給する光源1と、該光源からの光束を波面分割し、該波面分割された光束に基づいて複数の光源像を形成する波面分割部4と、前記複数の光源像からの光を被照射面上の所定照明領域へ導くコンデンサ光学系6～9と、前記光源部と前記波面分割部との間の光路中に配置されて、光束の進行方向を中心として回転可能に設けられた複屈折部材200とを備える



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光束を供給する光源と、該光源からの光束を波面分割し、該波面分割された光束に基づいて複数の光源像を形成する波面分割部と、前記複数の光源像からの光を被照射面上の所定照明領域へ導くコンデンサ光学系と、前記光源部と前記波面分割部との間の光路中に配置されて、光束の進行方向を中心として回転可能に設けられた複屈折部材と、を備えることを特徴とする照明装置。

【請求項2】 前記複屈折部材は、前記光束の断面方向において前記進行方向の厚みが異なる形状を有していることを特徴とする請求項1記載の照明装置。

【請求項3】 前記複屈折部材は、少なくとも2つの複屈折素子を含み、該少なくとも2つの複屈折素子のうちの少なくとも1つは、前記進行方向を中心として回転可能であることを特徴とする請求項1又は2記載の照明装置。

【請求項4】 前記複屈折素子のうちの少なくとも1つは、その光学軸の方向が光束の進行方向に対して略垂直となるように配設されていることを特徴とする請求項3記載の照明装置。

【請求項5】 前記所定照明領域は略矩形形状であり、前記複屈折素子のうちの少なくとも一つは固定されており、

前記固定された複屈折素子の光学軸の方向は、前記矩形形状の辺の方向と平行であることを特徴とする請求項3記載の照明装置。

【請求項6】 前記固定された複屈折素子は、前記回転可能な複屈折素子と前記波面分割部との間に配置されていることを特徴とする請求項5記載の照明装置。

【請求項7】 所定のパターンが形成されたマスクを照明する請求項1乃至6の何れか1項に記載の照明装置と、

該照明されたマスクのパターンを感光基板上に投影露光する投影光学系とを有することを特徴とする投影露光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は投影露光装置、特に半導体集積回路等を製造するために好適な投影露光装置及び該装置に搭載される照明装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、半導体集積回路の高集積化に伴い、投影露光装置の光源波長が短波長化している。例えば、光源としてKrFエキシマレーザを用いる投影露光装置は既に実用化されており、ArFエキシマレーザを用いる装置は研究段階から実用段階に移行しつつある。これらのレーザを光源とする投影露光装置では、光源の波長が短いため、透過部材として使用できる硝材が石英

硝子と萤石とに制限される。そのため、投影露光装置の投影レンズを光学設計するに際して、色収差の補正（色消し）が極端に困難となってしまう。また、原理上エキシマレーザの発振波長は半値幅でコンマ数nm程度の波長幅を有している。このため、色消しの諸条件を緩和するため、発振波長が半値幅でコンマ数pm程度になるよう狭帯化を行なっている。ここで、回折格子等を用いて発振波長の狭帯化を行うと、特定波長の増幅に加えて、特定の偏光成分のみ増幅してしまう。そして、特定の偏光成分を多く有する光束を用いて投影露光を行うと以下に述べる問題を生ずる。

【0003】 偏光した光束を光源として露光を行なうと、最終的に形成される像がパターンの方向により異なるという現象が生じる。例えば、メリジオナル方向に光束が偏光している場合は、像面においてあたかも該方向にNAが小さい像が形成される。また、サジタル方向に偏光している場合は、該方向にあたかもNAが大きい像が形成される。したがって、たとえ均一なNAの投影光学系でマスク等に形成されたパターンを結像しても、照明光束が偏光していると像面において偏ったNAで結像してしまうので、パターンの方向により解像が異なってしまう。かかる現象は、特に、高NAの場合に著しい。詳しくは大木裕史：“フレッシュマンの為の現代光学、焦点近傍の光学”、光学、21（1992）8月号に記載されているので省略する。

【0004】 一方、半導体集積回路はメモリ回路からロジック回路へと主流が移行しつつある。ロジック回路用の半導体集積回路は独立した単独のパターンを有しており、パターン線幅が均一であることが望ましい。ロジック回路用の半導体集積回路においてパターンの方向により解像が異なると、ロジック回路の処理速度の低下を招くので好ましくない。このため、ArF又はKrFエキシマレーザを光源として用いる、例えば特許第2679319号公報に開示されている従来の投影露光装置では、以下に述べる方法で対応している。

【0005】 図6は従来の投影露光装置の概略構成を示す図である。射出する光束の断面形状が矩形であるエキシマレーザ1からの光束は、整形光学系2により適切な形状、アスペクト比の光束に変換され、後述する水晶板100、石英硝子101を透過した後、単レンズを並列に高密度に配置した光学素子であるフライアイレンズ4に入射する。図7はフライアイレンズを光束の進行方向（x軸方向）より観察した図である。フライアイレンズ4により各要素レンズ毎に分割された光束は、レンズ6、視野絞り7、レンズ9を透過した後、反射ミラー8で90度折り曲げられレンズ9'を透過して、マスク10上に集光される。ここで、レンズ6、9、9'によりコンデンサレンズ群を構成する。図8(a)、(b)にフライアイレンズ4入射面からマスク10に至るまでの光線の様子を示す。なお、簡便のため図8において、レ

ンズ6からレンズ9に至る光学系を単にレンズL1と示す。図8(a)において、フライアイレンズ4の入射面に集光した光束aはコンデンサレンズL1によりマスク10面上の位置a'に集光される。即ち、フライアイレンズ4の各要素レンズ入射面とマスク10とは共役に構成されている。また、図8(b)に示すように、フライアイレンズ4の射出面に集光した光束bは、レンズL1で平行光に変換されてマスク10を照射する。この結果、フライアイレンズ4に入射した光束は、要素レンズ単位に波面分割され、マスク10上で重ねあわせる。そして、マスク10に供給された照明光に基づき、投影光学系11によりマスク10上のパターンが、ウエハ15に転写される。投影光学系11は、レンズL1, L2, L3とミラー13, 14と反射凹面鏡Mとから構成され、開口絞り12を有している。ここで、視野絞り7は、コンデンサレンズ群6～9の中の、マスク10と共に位置に配設され、照明範囲を規定している。また、フライアイレンズ4射出面は、投影レンズの開口絞り12と共に位置に配設され、照明範囲を規定している。また、フライアイレンズ4射出面は、投影レンズの開口絞り12と共に位置に配設され、照明範囲を規定している。

【0006】上述したようにエキシマレーザ1から射出される光束の形状は一般に矩形であり、矩形の短辺に平行に偏光している。また、照明の効率を極力高く保つために、矩形形状のレーザ射出光束をシリンドリカルレンズ等で構成された整形光学系2によりフライアイレンズ4の外形に極力フィットさせることが望ましい。図9は、整形したレーザ射出光束 α とフライアイレンズ4との関係を示す図である。偏光方向 $p\circ$ は矩形の辺に平行である。フライアイ要素レンズ入射面は、マスク10と共に位置に配設する。このため、被照明面であるマスク10上には、矩形形状の照明領域の辺に平行な偏光が供給されるので、上述のような偏光方向に起因する結像光束のNAの変化を生じるので好ましくない。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】偏光に起因する問題を解消するために、擬似的な自然光を得る構成について説明する。楔状に加工した一軸結晶である水晶部材100を光源1とフライアイレンズ4との間に配設する。そして、水晶部材100のみでは、屈折作用により光束の進行方向が曲がってしまうので、進行方向を補正するため、水晶部材100と同様に楔状に加工した石英硝子101を図6のように配設する。

【0008】水晶部材(一軸結晶)100の光学軸の方向と、偏光方向と、フライアイレンズとの関係を図10(a)～(c)に示す。図10(a)はフライアイレンズ4に入射する光束 α の断面形状、同図(b)は水晶部材の光学軸 $o\circ p\circ x$ 、同図(c)はフライアイレンズ4の形状をそれぞれ示している。水晶部材の光学軸 $o\circ p\circ x$ は光束の進行方向に垂直で、かつ偏光方向 $p\circ$ に対し

て45度の角度に設定する。かかる構成によれば、水晶部材100は楔状に加工されているため、光束が入射する位置により水晶部材を透過する厚み(透過距離)が異なる。このため、水晶への入射位置によって、射出する光束の偏光状態が異なる。例えば、水晶部材100に入射する入射光の偏光方向が図11(a)のような場合に、射出光の偏光は、縦の直線偏光(図11(b))、横の直線偏光(図11(d))、それらの中間の円偏光(図11(c), (e))、さらには橢円偏光となる。そして、フライアイレンズとコンデンサレンズとを透過することで、様々な偏光状態の波面を分割、重ねあわせるため、マスク10上では、様々な方向の偏光が重なり合った状態、すなわち擬似的な自然光を得ることができる。このように水晶部材100を用いることで特定の偏光状態の光束に基づく、結像面(ウエハ15)におけるNAの不均一、結像したパターンの解像のバラツキを防止することができる。

【0009】しかし、上記構成の投影露光装置は以下に述べる問題点を有している。実際の投影露光装置は、装置の小型化等の理由から、光束の進行方向を折り曲げるために複数の反射ミラーが用いられている。図6に示した投影露光装置は、4枚の反射ミラー3, 8, 13及び14を有している。例えば、ミラー3, 4の折り曲げを無くして一直線状に光学系を配置すると、全長が非常に長い光学系になってしまふ。また、ミラー13の折り曲げを無くしてしまうと、物理的に光学系の配置が不可能になってしまふ。

【0010】したがって、投影露光装置の光学系では反射ミラーは不可欠な光学素子である。しかし、ArFエキシマレーザなどから発振される短波長の光に対しては、P波とS波との反射率が等しい反射ミラーを製造することができない。このため、反射ミラーで光束を折り曲げることにより、自然光でマスクを照明しても、ウエハ等の被露光面上では光束が偏光気味となってしまうという問題がある。従来装置のように、直線偏光のレーザ発振光を水晶部材を透過させることでマスク面上で擬似的な自然光に変換しても、その後の光学系において反射ミラーで光路を折り曲げることでp成分又はs成分などの特定の偏光成分を有する光束になってしまふ。したがって、特定の偏光成分に起因するウエハ上に結像する際のNAの不均一によるパターン解像、線幅のバラツキを生じてしまう。

【0011】ここで、従来装置において光束の折り曲げによる偏光成分の比率の変化を防止する為には、レーザ光源及び整形光学系を回転させて、水晶部材への入射光束そのものを回転させることで偏光の方向による比率を変えることが考えられる。しかし、入射光束そのものを回転させて、特定の偏光の方向をミラーの折り曲げ方向に合わせると、光束の形状と偏光の方向が固定している場合、矩形のフライアイレンズに対して矩形の光束が回

転して入射することになる。この結果、フライアイレンズの矩形領域と、光束の矩形領域とが一致せず、光束がフライアイレンズでけられるので、有効に光量を使用することができず照明効率の低下を招いてしまう。

【0012】本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、光源の偏光の方向による比を、任意の方向に対して任意の強度比に簡便に調整できる照明装置及び該照明装置を備える投影露光装置を提供することを目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するためには、請求項1記載の発明では、光束を供給する光源と、該光源からの光束を波面分割し、該波面分割された光束に基づいて複数の光源像を形成する波面分割部と、前記複数の光源像からの光を被照射面上の所定照明領域へ導くコンデンサ光学系と、前記光源部と前記波面分割部との間の光路中に配置されて、光束の進行方向を中心として回転可能に設けられた複屈折部材と、を備えることを特徴とする。

【0014】また、請求項2記載の発明では、前記複屈折部材は、前記光束の断面方向において前記進行方向の厚みが異なる形状を有していることを特徴とする。

【0015】また、請求項3記載の発明では、前記複屈折部材は、少なくとも2つの複屈折素子を含み、該少なくとも2つの複屈折素子のうちの少なくとも1つは、前記進行方向を中心として回転可能であることを特徴とする。

【0016】また、請求項4記載の発明では、前記複屈折素子のうちの少なくとも1つは、その光学軸の方向が光束の進行方向に対して略垂直となるように配設されていることを特徴とする。

【0017】また、請求項5記載の発明では、前記所定照明領域は略矩形形状であり、前記複屈折素子のうちの少なくとも1つは固設されており、前記固設された複屈折素子の光学軸の方向は、前記矩形形状の辺の方向と平行であることを特徴とする。

【0018】また、請求項6記載の発明では、前記固設された複屈折素子は、前記回転可能な複屈折素子と前記波面分割部との間に配置されていることを特徴とする。

【0019】また、請求項7記載の発明では、所定のパターンが形成されたマスクを照明する請求項1乃至6の何れか1項に記載の照明装置と、該照明されたマスクのパターンを感光基板上に投影露光する投影光学系とを有することを特徴とする。

【0020】

【発明の実施の形態】以下、添付図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。

(第1実施形態) 図1は、本発明の第1の実施の形態にかかる照明装置と該照明装置を備える投影露光装置の構成を示す図である。ArFエキシマレーザ(波長λ=約

193nm)等の光源1からの光束は、シリンドリカルレンズ等を含む整形光学系2により光束径の拡大とアスペクト比の変更がなされる。なお、光源1は紙面に平行な直線偏光を射出することが望ましい。次に、整形された光束は第1の楔型プリズムの組200, 201を透過し、さらに第2の楔型プリズムの組202, 203を経て、フライアイレンズ4に導かれる。プリズム200～203は光束の断面方向において進行方向の厚みが異なるような楔形状に加工されている。プリズム200～203についての詳細は後述する。次に、光源からの光束は、フライアイレンズ4で波面分割され複数の光源像が形成される。フライアイレンズ4の射出面には、ウエハ面上での照明光の開口数を決定する為の開口絞り5が設けられている。そして、複数の光源像からの光は、レンズ6、レンズ9を透過した後、反射ミラー8で90度折り曲げられて、レンズ9'を透過しパターンを有するマスク10を照明する。ここで、レンズ6とレンズ9とレンズ9'ことでコンデンサ光学系を構成する。コンデンサ光学系内のマスク10と共に位置に視野絞り7が配置されている。そして、マスク10に供給された照明光に基づき、投影光学系11によりマスク10上のパターンが、ウエハ15に転写される。投影光学系11は、レンズL1, L2, L3とミラー13, 14と反射凹面鏡Mとから構成され、開口絞り12を有している。このように本実施形態の投影光学系11は、ミラー13等の反射面を有していることが望ましい。ここで、視野絞り7は、コンデンサ光学系6～9の中の、マスク10と共に位置に配設され、照明範囲を規定している。また、フライアイレンズ4の射出面は、投影レンズの開口絞り12と共に位置である。

【0021】次に、プリズム200～203について説明する。プリズム200とプリズム202とは、楔形状に加工された水晶結晶から成っている。上記従来技術で述べたように、水晶プリズムのみであると屈折作用で光路が曲がるので、楔形状に加工された石英硝子201と203とをそれぞれ組み合わせることで、光束の進行方向を補正している。また、各プリズムの楔の角度は、プリズムに垂直に入射した光束が、ほぼ垂直に射出するように設定されている。そして、水晶プリズム200と石英プリズム201とはモータMTにより一体として光軸AXを中心として回転可能に構成されている。一方、水晶プリズム202と石英プリズム203とは固定されている。

【0022】水晶プリズム200と202の光学軸の方向を図2(a), (b)にそれぞれ示す。ここで、光軸の方向をx、光軸に垂直でかつ図1の紙面内の方向をy、図1の紙面に垂直な方向をzとする。また、水晶プリズム200の光学軸o_{px}とy軸とのなす角をαとする。図2(b)に示すように、固定されている水晶プリズム202の光学軸o_{px}の方向はマスク上の照明

される矩形状の領域の辺の方向と平行である。ただし、光束をミラーなどで折り曲げている場合は、折り曲げが無いものとして考える。また、水晶プリズム200と202とのうち少なくとも1つは、その光学軸の方向が光束の進行方向に対して略垂直となるように配設されていることが望ましい。

【0023】本実施形態において反射ミラー8、13、14等の折り曲げ方向は全て図1の紙面に垂直な軸に対する回転方向となっている。このため、ウエハ15面上における光束は、図1の紙面に平行な方向の偏光は弱めに、紙面に垂直な方向の偏光は強めになる。このため、プリズム200、202により形成される光束の偏光の強度比が、y方向は強め、z方向は弱めに、かつその比を任意に選択できる必要がある。y方向の直線偏光の光束がプリズム200、201を透過した後は、様々な状態の偏光に変換される。そのうち直線偏光のみに着目すると、図3に示すようにy方向の直線偏光と、y軸と($\psi \times 2$)の角度をなす偏光とに、強度比が1:1で分離されている。さらに、プリズム202、203を透過すると、y方向の直線偏光は全く変化を受けずにそのまま通過し、y軸と($\psi \times 2$)の角度をなす偏光はy軸に対して($\psi \times 2$)の角度をなす偏光と、y軸に対して-($\psi \times 2$)の角度をなす偏光とに強度1:1で分離される。この様子を図4に示す。即ち、プリズム200～203を透過した後のy方向の偏光強度をA、z方向の偏光強度をB、水晶プリズム200の回転角度を ψ とおくと、 $A : B = 1 + \cos(2\psi) : \sin(2\psi)$ となる。このことより、本実施形態において、y方向が多め、z方向が少なめの偏光を得る事ができることがわかる。さらに、回転角度 ψ は可変であるため、AとBとの比は任意に選択する事ができる。好ましくは、ウエハ15面上で偏光量を測定しながら、方向による偏光の量の比が等しくなるように水晶プリズム200を回転し、 ψ を選択することが望ましい。

【0024】(第2実施形態)本発明の第2の実施の形態にかかる照明装置及び該照明装置を備える投影露光装置の基本的な構成は上記第1実施形態と同様であるので、図による説明は省略する。上記第1実施形態と異なる点は、プリズム200～203の代わりに第1の楔型プリズムの組200、201のみを用いる点にある。水晶プリズム200の光学軸の方向を光軸AXの回りにモータMTにより回転させることで得られる偏光状態を図5(a)から(c)に示す。尚、この場合円偏光は問題にならないので直線偏光のみを図示する。(a)は光学軸と偏光方向のなす角が45°の場合(図11と同じ図)、(b)は30°の場合、(c)は60°の場合である。図より明らかに、この方法では、特定の斜め方向(光学軸の方向)の偏光を強くすることができる。第1実施形態のように、ミラーで光束を折り曲げるに際して、矩形の照野の何れかの辺に平行な軸に対して折り

曲げを行なう場合は、偏光の強度比は光束の矩形の辺に平行な2方向(図1中の、y、z方向)の比のみが変化することが必要である。しかし、ミラーによる折り曲げ方向に制約が無い場合は、光学軸の方向と、偏光の強度比を変化させたい方向とを水晶プリズム200を回転させて一致させることができる。したがって、1つの水晶プリズム200を回転させることで、望む方向の強度比を変化させることができる。

【0025】なお、上記実施形態ではフライアイレンズを一つだけ用いた照明系を用いたが、フライアイレンズとコンデンサレンズとの組を直列に複数設け、光束の波面分割と重ねあわせとを複数回行なう照明系を用いても良い。例えば、フライアイレンズとコンデンサレンズとの組を直列に二組配列した構成は、一般にダブルフライアイシステムと呼ばれる。かかる構成の場合、水晶部材等の複屈折媒質は、光源側から順に数えて第1番目のフライアイレンズよりも光源側に配置する事が望ましい。

【0026】

【発明の効果】以上説明したように、請求項1記載の発明では、複屈折部材を回転することにより、特定の方向の偏光の強度比を制御できる。従って、光束のミラーによる折り曲げ方に起因する被露光面(ウエハ)上に到達する光の偏光の影響を無くすことができる。

【0027】また、請求項2記載の発明では、複屈折部材は光束の断面方向において、光束の進行方向の厚みが異なっている。従って、直線偏光が入射した場合に、複屈折部材に入射する光束の位置により該部材を透過する距離が異なるので、射出側で様々な状態の偏光が得られる。

【0028】また、請求項3記載の発明では、少なくとも2つの複屈折素子を有しており、そのうち一方が回転可能である。従って、任意の方向の偏光の強度比を制御できる。

【0029】また、請求項4記載の発明では、光学軸の方向が光束の進行方向に対して略垂直になっている。従って、偏光量の制御がさらに容易になる。

【0030】また、請求項5記載の発明では、マスク上の照明領域は略矩形形状であり、固設されている複屈折素子の光学軸の方向が前記矩形形状の辺の方向と平行である。従って、レーザ光源から射出し整形された光束の断面形状が矩形形状の場合でも、光量の損失なく効率よく照明でき、かつ照明領域の辺の方向に合わせて偏光の強度比を制御することができる。

【0031】また、請求項6記載の発明では、固設された複屈折素子は、回転可能な複屈折素子と波面分割部との間に配置されている。従って、ミラーの駆動回転部がフライアイレンズ等の光学系から離れているので、安定した照明を行うことができる。

【0032】また、請求項7記載の発明では、本発明に係る照明装置を用いることで、光束の折り曲げ方向に依

存する偏光の影響を避けることができ、常に良好な解像のパターンを投影、露光することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る照明装置とそれを備えた投影露光装置の構成を示す図である。

【図2】水晶プリズムの光学軸の方向を説明する図である。

【図3】水晶プリズム200を透過した後の偏光の様子を説明する図である。

【図4】水晶プリズム200と202を透過した後の偏光の様子を説明する図である。

【図5】水晶プリズム200を回転した場合の偏光の様子を説明する図である。

【図6】従来の投影露光装置の構成を示す図である。

【図7】フライアイレンズの構成を示す図である。

【図8】(a), (b)はフライアイレンズからマスクに至る系を説明する図である。

【図9】整形したレーザ射出光束 α とフライアイレンズ4との関係を示す図である。

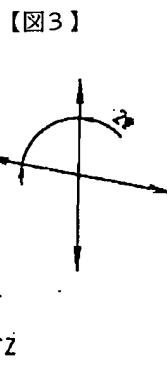
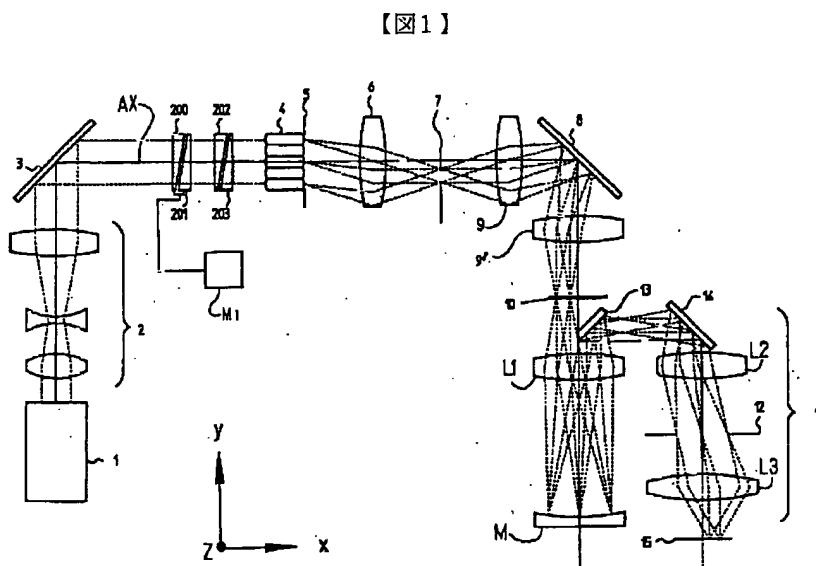
【図10】(a)～(c)は、水晶部材(一軸結晶)1

00の光学軸の方向と、偏光方向と、フライアイレンズとの関係を示す図である。

【図11】(a)～(e)は水晶部材100からの射出光の偏光の状態を示す図である。

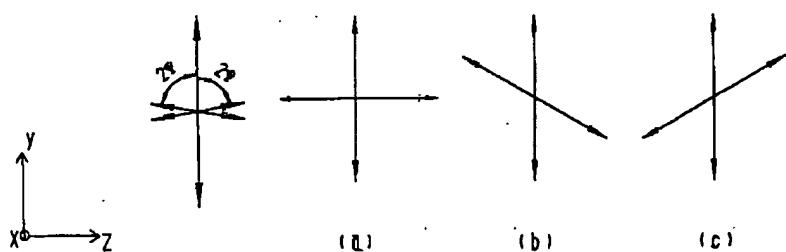
【符号の説明】

- 1 光源
- 2 整形光学系
- 3, 8, 13, 14 反射ミラー
- 200, 202 水晶プリズム
- 201, 203 石英プリズム
- 4 フライアイレンズ
- 5 開口絞り
- 6, 9, 9' コンデンサレンズ
- 7 視野絞り
- 10 マスク
- L1, L2, L3 レンズ
- 11 投影光学系
- 12 開口絞り
- 15 ウエハ
- M 凹面ミラー

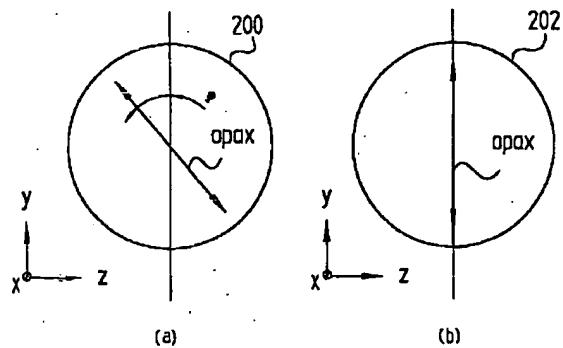


【図4】

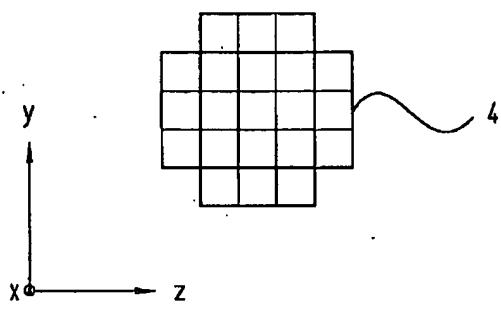
【図5】



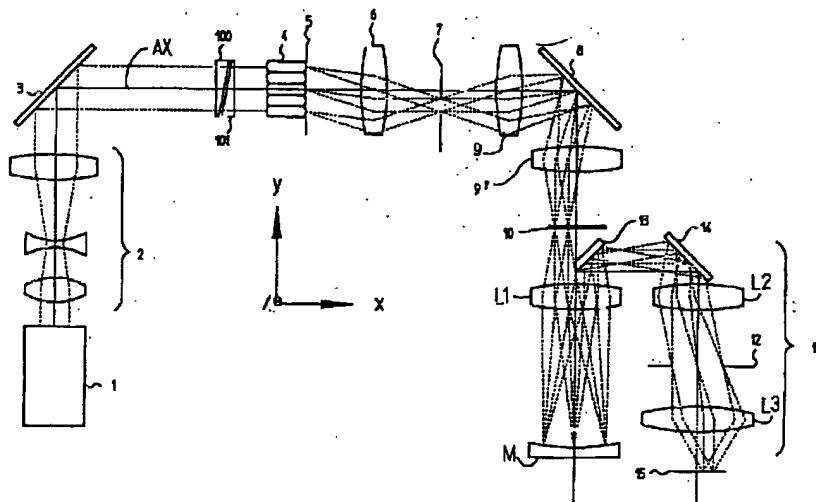
【図2】



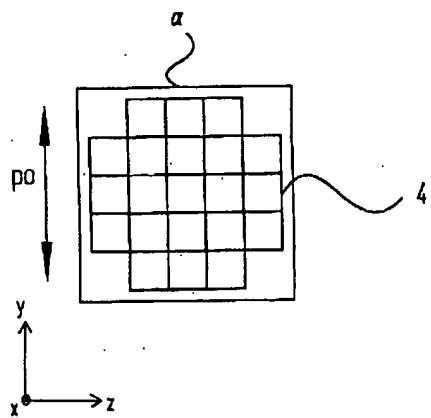
【図7】



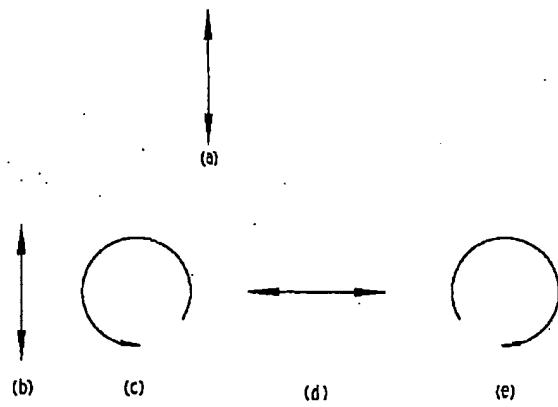
【図6】



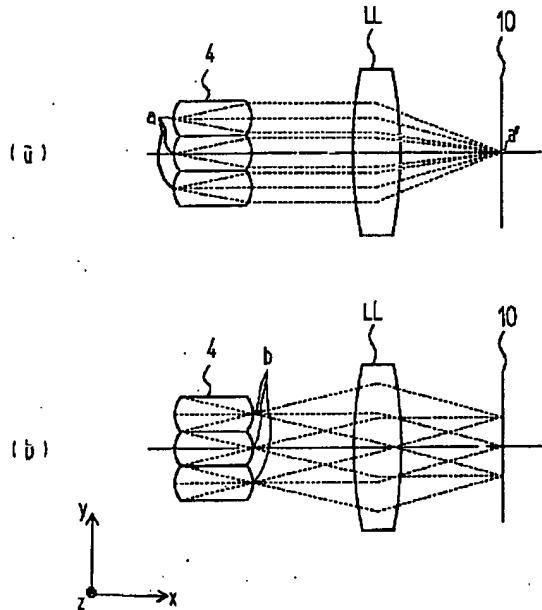
【図9】



【図11】



【図8】



【図10】

